

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-229048
 (43)Date of publication of application : 14. 08. 2002

(51) Int. Cl. G02F 1/1343
 G02F 1/1335
 G02F 1/1337

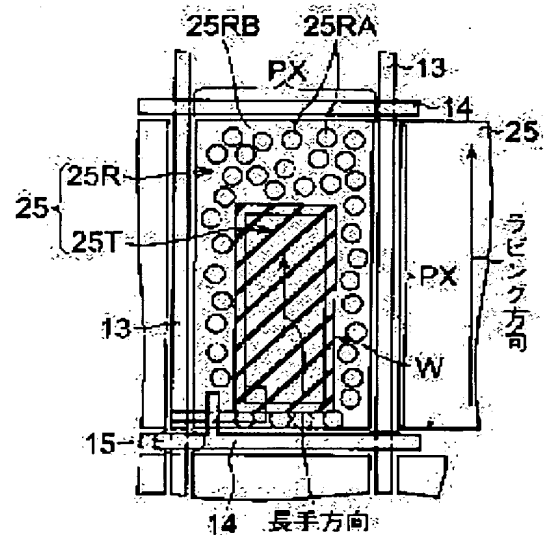
(21)Application number : 2001-021997 (71)Applicant : TOSHIBA CORP
 (22)Date of filing : 30. 01. 2001 (72)Inventor : YOSHIDA NORIHIRO
 MURAYAMA AKIO
 YAMADA YOSHITAKA
 HANAZAWA YASUYUKI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To decrease the orientation defects of liquid crystal molecules which becomes the cause for light leakage.

SOLUTION: The liquid crystal display device has an array substrate and a counter substrate and liquid crystal layers grasped as the cells of a liquid crystal composition between the array substrate and the counter substrate; the array substrate includes pixel electrodes 25, having reflection conductive layers 25R and transmission conductive layers 25T arranged as windows W for the reflection conductive layers 25R as well alignment layers for covering the reflection conductive layers 25R and the transmission conductive layers 25T. The windows W of the reflection conductive layers 25R are a rectangular shape, having the longitudinal direction approximately aligned to the rubbing direction of the alignment layers.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-229048

(P2002-229048A)

(43) 公開日 平成14年8月14日 (2002.8.14)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード* (参考)
G 0 2 F	1/1343	G 0 2 F	1/1343
	1/1335		1/1335
	1/1337		1/1337
	5 2 0		5 2 0
	5 0 0		5 0 0

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願2001-21997(P2001-21997)

(22) 出願日 平成13年1月30日 (2001.1.30)

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72) 発明者 吉田 典弘

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2号 株

式会社東芝深谷工場内

(72) 発明者 村山 昭夫

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2号 株

式会社東芝深谷工場内

(74) 代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

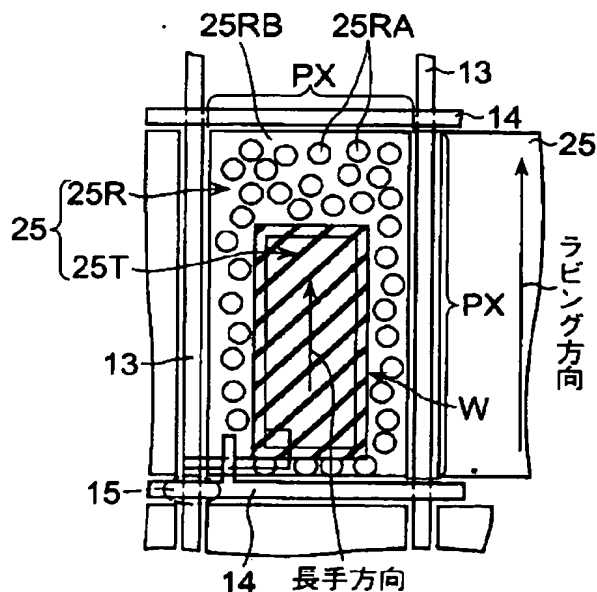
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 光漏れの原因となる液晶分子の配向不良を低減する。

【解決手段】 液晶表示装置はアレイ基板および対向基板と、これらアレイ基板および対向基板間に液晶組成物のセルとして挟持される液晶層とを備え、アレイ基板は反射導電層25Rおよび反射導電層25Rの窓Wとして配置される透過導電層25Tを持つ画素電極25、並びに反射導電層25Rおよび透過導電層25Tを覆う配向膜を含む。反射導電層25Rの窓Wは配向膜のラビング方向に略一致する長手方向を持つ長方形である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1および第2電極基板と、前記第1および第2電極基板間に液晶組成物のセルとして挟持される液晶層とを備え、前記第1電極基板は光反射部および前記光反射部の窓として配置される光透過部を持つ電極、並びに前記光反射部および光透過部を覆う配向膜を含み、前記光反射部の窓は前記配向膜のラビング方向に略一致する長手方向を持つ形状であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記光反射部は入射光を反射する反射導電層により構成され、前記光透過部は入射光を透過する少なくとも1個の透過導電層により構成されることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 各透過導電層は光透過性の絶縁基板上に形成され、前記反射導電層は各透過導電層を露出させて前記絶縁基板を覆う絶縁膜上に形成されることを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記光反射部は入射光を反射する反射導電層により構成され、前記光透過部は入射光を透過するように前記反射導電層に形成される少なくとも1個の切欠部により構成されることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記切欠部は前記長手方向に直角な方向において幅10 μ m以下で形成されることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記第2電極基板は前記電極に対向する対向電極およびこの対向電極を覆う配向膜を含み、前記第2電極基板の配向膜のラビング方向は前記液晶層の液晶分子配列に所定の捻れを持たせるように前記第1電極基板の配向膜のラビング方向に基づいて決定されることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記反射導電層は反射光を散乱させる凹凸パターンを持つことを特徴とする請求項2または4に記載の液晶表示装置。

【請求項8】 前記凹凸パターンは前記反射導電層の下地の起伏に依存することを特徴とする請求項7に記載の液晶表示装置。

【請求項9】 光反射部および前記光反射部の窓として配置される光透過部を持つ電極、並びに前記光反射部および光透過部を覆う配向膜を一方に含む第1および第2電極基板を形成する工程と、前記第1および第2電極基板間に液晶組成物のセルとして挟持される液晶層を形成する工程とを備え、前記光反射部の窓が長手方向を持つ形状であり、さらに前記窓の長手方向に略一致する方向に前記配向膜をラビングする工程を備えることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は液晶層が一对の電極基板間に液晶組成物のセルとして挟持される液晶表示装

置およびその製造方法に関し、特に透過光および反射光を併用して画像を表示する液晶表示装置およびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年では、軽量、小型、高精細な液晶表示装置がコンピュータを中心とする情報機器分野およびテレビなどを中心とする映像機器分野で盛んに開発されている。一般的な液晶表示装置は一对の電極基板間に液晶層を挟持した構造を有し、光源光を液晶層で光学変調することにより画像を表示する。

【0003】 この液晶表示装置は、例えば背面または背面側方に配置されるバックライトからの光を透過させる透過型および周囲からの光を反射させる反射型に分類される。これら透過型および反射型のいずれも、表示画像が液晶表示装置に入射する周囲光の影響を受ける。透過型での表示画像は周囲光が明るすぎる場合に見にくくなり、反射型での表示画像は周囲光が暗すぎる場合に見にくくなる。

【0004】 このような問題を解決するため、例えば特開平11-316382は光透過率の高い光透過導電層と反射効率の高い光反射導電層とを各画素内に配置して透過光および反射光を併用する方式を開示する。この方式では、一方の電極基板が光透過性絶縁基板およびこの絶縁基板を覆う有機絶縁膜を有し、光透過導電層が有機絶縁膜の一部に形成された開口内に配置され、光反射導電層が光透過導電層の周囲において有機絶縁膜上に配置される。これら光透過導電層および光反射導電層は配向膜により覆われる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、この配向膜はラビング布で所定方向にラビング処理されることにより液晶分子の配向を制御する。しかし、ラビング布は開口付近の段差のために均一に配向膜をラビングできないため、配向不良による光漏れが発生し、これがコントラストを低下させる結果となっている。

【0006】 本発明の目的は、上述のような課題に鑑み、光漏れの原因となる液晶分子の配向不良を低減できる液晶表示装置およびその製造方法を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】 本発明によれば、第1および第2電極基板と、これら第1および第2電極基板間に液晶組成物のセルとして挟持される液晶層とを備え、第1電極基板は光反射部およびこの光反射部の窓として配置される光透過部を持つ電極、並びにこれら光反射部および光透過部を覆う配向膜を含み、光反射部の窓は配向膜のラビング方向に略一致する長手方向を持つ形状である液晶表示装置が提供される。

【0008】 本発明によれば、さらに光反射部およびこの光反射部の窓として配置される光透過部を持つ電極、

並びに光反射部および光透過部を覆う配向膜を一方に含む第1および第2電極基板を形成する工程と、第1および第2電極基板間に液晶組成物のセルとして挟持される液晶層を形成する工程とを備え、前記光反射部の窓が長手方向を持つ形状であり、さらに窓の長手方向に略一致する方向に配向膜をラビングする工程を備える液晶表示装置の製造方法が提供される。

【0009】この液晶表示装置およびその製造方法において、光反射部の窓は配向膜のラビング方向に略一致する長手方向を持つ形状であり、この光反射部および光透過部間に生じた段差を補償する。この場合、窓の長手方向が配向膜のラビング方向から大きくずれている場合よりもラビング布が段差の影響で十分ラビングできない配向膜の領域を削減できる。従って、光漏れの原因となる配向不良を低減して、高いコントラストを得ることができる。

【0010】

【発明の実施の形態】以下、本発明の第1実施形態に係る液晶表示装置について添付図面を参照して説明する。この液晶表示装置は透過光および反射光を併用して画像を表示する方式である。

【0011】図1は液晶表示装置の部分的な断面構造を示し、図2は図1に示す画素付近の平面構造を示す。この液晶表示装置は図1に示すようにアレイ基板AR、対向基板CT、これら基板ARおよびCT間に挟持される液晶層LQを備える。

【0012】アレイ基板ARは光透過性の絶縁基板21、この絶縁基板21上でマトリクス状に配置される複数の画素電極25、これら画素電極25の列に沿って配置される複数の信号線13、これら画素電極25の行に沿って配置される複数の走査線14、各々対応走査線14および対応信号線13の交差位置近傍に画素用スイッチング素子として配置される複数の薄膜トランジスタ(TFT)23、複数の走査線14および複数の信号線13を駆動する駆動回路、および複数の画素電極25を覆う配向膜27Aを含む。対向基板CTは光透過性の絶縁基板22と、各々対応列の画素電極25に対向して行方向に順番に並ぶ赤、緑、および青のストライプとして絶縁基板22上に形成されるカラーフィルタ24と、カラーフィルタ24を覆う透明対向電極29と、この対向電極29を覆う配向膜27Bとを有する。また、位相差板RT1および偏光板PL1が複数の画素電極25とは反対側において絶縁基板21に貼り付けられ、位相差板RT2および偏光板PL2がカラーフィルタ24とは反対側において絶縁基板22に貼り付けられる。

【0013】この液晶表示装置では、液晶層LQが複数の画素電極25にそれぞれ対応して複数の画素領域PXに区画され、各画素領域PXが各々2本の隣接走査線14と2本の隣接信号線13との間に配置される。各薄膜トランジスタ23は対応走査線14から供給される走査

パルスにตอบสนองして対応信号線13の電位を対応画素電極25に供給する。各画素電極25は対応信号線13の電位を画素電位として液晶層LQの対応画素領域PXに印加し、この画素電位と対向電極29の電位との電位差に基づいて画素領域PXの透過率を制御する。また、各画素電極25は例えば銀、アルミニウム、あるいはこれらの合金のような金属の反射導電層25Rおよびこの反射導電層25Rの窓Wとして配置されるITO等の透過導電層25Tを有する。反射導電層25Rは対向基板CT側から液晶層LQを介して入射する光を高い反射率で反射し散乱させる光反射部を構成し、透過導電層25Tはアレイ基板ARの背面から入射する光を液晶層LQ側に透過する光透過部を構成する。反射導電層25Rの窓Wは配向膜27Aのラビング方向に略一致する長手方向を持つ長方形である。

【0014】アレイ基板ARでは、複数の薄膜トランジスタ23、複数の反射導電層25Tその他の配線が光透過性絶縁基板21上に形成され、有機絶縁膜31で絶縁基板21と共に覆われる。この有機絶縁膜31は各々対応透過導電層25Tを部分的に露出する複数の開口31Hおよびこれら開口31Hをそれぞれ囲むように複数の画素領域PXに対応して配置される凹凸パターンを有する。各薄膜トランジスタ23は対応走査線14に接続されるゲート、対応画素電極25の透過導電層25Tに接続されるソース、および対応信号線13に接続されるドレインを有する。各画素電極25の反射導電層25Rは対応透過導電層25Tの外縁にコンタクトして有機絶縁膜31上に形成される。この反射導電層25Rは有機絶縁膜31の凹凸パターンに沿って所定の厚さで形成され、ランダムに配置される複数の半球状凸部25RAおよびこれら半球状凸部25RAを囲んで配置される凹部25RBを凹凸パターンとして含む。この反射導電層25Rはこの凹凸パターンにより入射光を散乱させるように反射する。

【0015】次に、上述した液晶表示装置の製造工程を説明する。

【0016】アレイ基板ARの製造では、複数の薄膜トランジスタ23、複数の透過導電層25T、その他の配線が通常の成膜およびパターニングを繰り返して高歪点ガラス板や石英板等の光透過性絶縁基板21上に形成される。続いて、例えばポジ型感光性の樹脂がスピンコート法などにより絶縁基板21全体を覆う厚さ1 μ m~4 μ m程度の有機絶縁膜31として塗布される。絶縁基板21のプリベーク後、有機絶縁膜31は開口用フォトマスクを用いて複数の開口31Hに対応する範囲で部分的に露光され、さらに信号線13および走査線14に重ならないように各画素領域PXの範囲においてランダムなピッチで配置された複数の円形遮光部を持つ凹凸パターン用フォトマスクを用いて露光される。ここでは、凹凸パターン用露光量が10~200mJに設定され、開口

用露光量が200～2000mJに設定され、円形遮光部の直径が2～20μm程度に設定される。凹凸パターンの起伏形状および密度はフォトマスクの開孔形状、密度、露光量等により制御される。

【0017】続いて、有機絶縁膜31が上述の露光部分を除去するために現像され、これにより複数の開口31Hと共に有機絶縁膜31の凹凸パターンを形成する。この段階では凹凸パターンが鋭角状の起伏となるため、絶縁基板21の熱処理がこの凹凸パターンを角のとれた滑らかな状態にするように行われる。

【0018】続いて、Al, Ni, CrおよびAg等の金属膜がスパッタ法により100nm程度の厚さで有機絶縁膜31上に堆積され、フォトリソ法で所定の形状にパターニングされ、これにより各々対応透過導電層25Tの外縁にコンタクトした複数の反射導電層25Rを形成する。

【0019】続いて、複数の柱状スペーサ15が液晶層LQの厚さとなる所定の間隙を確保するために所定領域に形成され、配向膜27Aが低温キュア型のポリイミドを印刷により画素電極25および有機絶縁膜31を覆うように3μm程度塗布しこれを反射導電層25Rの窓Wの長手方向(すなわち、反射導電層25Rと透過導電層25Tとの段差が最も長く伸びる方向)に一致するラビング方向にラビング布でラビング処理することにより形成される。

【0020】他方、対向基板CTの製造では、顔料などを分散させたカラーフィルタ24が高重量ガラス板や石英板等の光透過性絶縁基板22上に形成される。透明対向電極29は例えばITOをスパッタ法で着色層24上に堆積することにより形成される。続いて、配向膜27Bが低温キュア型のポリイミドを印刷により透明対向電極29を覆うように3μm程度塗布しこれをラビング布でラビング処理することにより形成される。尚、配向膜27Bのラビング処理は液晶層LQの液晶分子を略ホモジニアス配列とするように配向膜27Aに対して配向軸を合わせる、アレイ基板ARおよび対向基板CTは配向膜27Aおよび27Bの形成後に一体化される。具体的には、アレイ基板ARおよび対向基板CTが配向膜27Aおよび27Bを内側にして向かい合わせられ、エポキシ系熱硬化樹脂の接着剤である周縁シール材を介して貼り合わされる。液晶層LQはアレイ基板ARおよび対向基板CT間において周縁シール材で囲まれた液晶注入空間をセルとし、ネマチック液晶のような液晶組成物をこのセルに注入し紫外線硬化樹脂で封止することにより得られる。こうして液晶層LQがアレイ基板ARおよび対向基板CT間に挟持された状態で、位相差板RT1および偏光板PL1が複数の画素電極25とは反対側において絶縁基板21に貼り付けられ、位相差板RT2および偏光板PL2がカラーフィルタ24とは反対側において絶縁基板22に貼り付けられる。液晶表示装置は上述のよ

うにして完成する。

【0021】上述した第1実施形態の液晶表示装置によれば、反射導電層25Rの窓Wは図1に示すように反射導電層25Rおよび透過導電層25T間に有機絶縁膜31の厚さにより生じた段差を補償するよう配向膜27Aのラビング方向に略一致する長手方向を持つ長方形である。窓Wの長手方向および配向膜27Aのラビング方向を例えば12時間時計形式で表すとすれば、窓Wの長手方向が信号線13に平行な6時～12時の方向に設定される場合に、配向膜27Aのラビング方向も6時～12時の方向に設定される。このような液晶表示装置を実際に駆動したところ、幅約4μmの配向不良領域が図3の(a)に示すように窓Wの一短辺に沿って発生することが顕微鏡観察により確認された。しかし、目視観察では、透過光表示画像および反射光表示画像のいずれも高品位であった。特に透過光表示の場合には、350というコントラストを得ることができた。

【0022】第1比較例として、配向膜27Aのラビング方向を7時半～1時半の方向と9時～3時の方向とに変更することを除いて第1実施形態と同様な液晶表示装置を製造し、これを実際に駆動する実験を行った。すると、ラビング方向が7時半～1時半の方向である場合、配向不良領域が図3の(b)に示すように窓Wの一長辺および一短辺の両方に沿って発生することが顕微鏡観察により確認された。このときコントラストを測定すると、その結果は280であった。他方、ラビング方向が9時～3時の方向である場合、配向不良領域が図3の(c)に示すように窓Wの一長辺に沿って発生することが顕微鏡観察により確認された。このときコントラストを測定すると、その結果は260であった。すなわち、配向膜27Aのラビング方向が窓Wの長手方向から大きくずれると、ラビング布が段差の影響で十分ラビングされない配向不良領域の長さを増大させてしまう。従って、この配向不良領域に対応した光漏れにより300を超えるような高いコントラストを得ることができない。

【0023】第2比較例として、対向基板CT側の配向膜27Bをラビング処理しない垂直配向膜に変更しハイブリッド型液晶配列を得るようにしたことを除いて第1実施形態と同様な液晶表示装置を製造し、これを実際に駆動する実験を行った。すると、配向膜27Aのラビング方向も6時～12時の方向に設定される場合において最も高いコントラストが得られるという上述の結果と同様の傾向となった。尚、この比較例ではハイブリッド型液晶配列としたが、TN型液晶配列としてもよい。

【0024】次に、本発明の第2実施形態に係る液晶表示装置を説明する。図4はこの液晶表示装置の部分的な断面構造を示し、図5は図4に示す画素付近の平面構造を示す。この液晶表示装置は以下のことを除いて第1実施形態と同様に構成される。このため、図4および図5において第1実施形態と同様な部分を同一参照符号で示

し、その説明を省略する。

【0025】この液晶表示装置は図1に示すような透過導電膜25Tを持たない。その代わり、光透過部が光反射部の窓Wとして反射導電層25Rに形成される3個の切欠部25TCにより構成される。この切欠部25TCに対応する領域の液晶は反射導電層25Rのエッジで生じる漏れ電界を利用して駆動される。このため、有機絶縁膜31の各開口31Hは透過導電膜25Tを露出するためではなく、対応反射導電層25Rを対応薄膜トランジスタ23のソースに接続するためのコンタクトホールとして形成される。各切欠部25TCは幅 $4\mu\text{m}$ ×長さ $50\mu\text{m}$ という寸法の長方形である。この長方形の長手方向は図5に示すように配向膜27Aのラビング方向に略一致する。次に、第1実施形態と異なるアレイ基板ARの製造工程を説明する。アレイ基板ARの製造では、複数の薄膜トランジスタ23およびその他の配線が通常の成膜およびパターニングを繰り返して高歪点ガラス板や石英板等の光透過性絶縁基板21上に形成される。続いて、例えばボジ型感光性の樹脂がスピンコート法などにより絶縁基板21全体を覆う厚さ $1\mu\text{m}$ ～ $4\mu\text{m}$ 程度の有機絶縁膜31として塗布される。絶縁基板21のプリベーク後、有機絶縁膜31は開口用フォトマスクを用いて複数の開口31Hに対応する範囲で部分的に露光され、さらに信号線13および走査線14に重ならないように各画素領域PXの範囲においてランダムなピッチで配置された複数の円形遮光部を持つ凹凸パターン用フォトマスクを用いて露光される。ここでは、第1実施形態と同様に、凹凸パターン用露光量が $10\sim 200\text{mJ}$ に設定され、開口用露光量が $200\sim 2000\text{mJ}$ に設定され、円形遮光部の直径が $2\sim 20\mu\text{m}$ 程度に設定される。凹凸パターンの起伏形状および密度はフォトマスクの開口形状、密度、露光量等により制御される。

【0026】続いて、有機絶縁膜31が上述の露光部分を除去するために現像され、これにより各々対応薄膜トランジスタ23のソースを露出する複数の開口31Hと共に有機絶縁膜31の凹凸パターンを形成する。この段階では凹凸パターンが鋭角状の起伏となるため、絶縁基板21の熱処理がこの凹凸パターンを角のとれた滑らかな状態にするように行われる。

【0027】続いて、Al、Ni、CrおよびAg等の金属膜がスパッタ法により 100nm 程度の厚さで有機絶縁膜31上に堆積され、フォトリソ法で各画素領域PXについて図5に示す所定の形状にパターニングされ、これにより各々対応薄膜トランジスタ23のソースにコンタクトすると共に3個の切欠部25TCを持つ複数の反射導電層25Rを形成する。

【0028】続いて、複数の柱状スペーサ15が液晶層LQの厚さとなる所定の間隙を確保するために所定領域に形成され、配向膜27Aが低温キュア型のポリイミドを印刷により画素電極25および有機絶縁膜31を覆う

ように $3\mu\text{m}$ 程度塗布し、これを図5に示すように反射導電層25Rの窓Wの長手方向(すなわち、光反射部と光透過部との段差が最も長く伸びる方向)に一致するラビング方向にラビング布でラビング処理することにより形成される。

【0029】この後、対向基板CTの製造工程、並びにアレイ基板ARと対向基板CTとの一体化工程が第1実施形態と同様に行われる。

【0030】上述した第2実施形態の液晶表示装置によれば、反射導電層25Rの切欠部25TCが光反射部の窓Wとして形成され、この窓Wが光反射部および光透過部間に反射導電層25Rの厚さにより生じた段差を補償するよう配向膜27Aのラビング方向に略一致する長手方向を持つ長方形である。すなわち、窓Wの長手方向が7時半～1時半の方向に設定される場合に、配向膜27Aのラビング方向も7時半～1時半の方向に設定される。この場合、窓Wの長手方向が配向膜27Aのラビング方向から大きくずれている場合よりもラビング布が段差の影響で十分ラビングできない配向膜27Aの領域を削減できる。従って、光漏れの原因となる配向不良を低減して、高いコントラストを得ることができる。このような液晶表示装置を実際に駆動したところ、目視観察で高品位な表示画像が確認された。また、透過光表示で20というコントラストを得ることができた。特に、複数の切欠部25TCが $10\mu\text{m}$ 以下の幅で形成されるような場合には、配向不良による光漏れで低下するコントラストを大幅に改善することが可能である。

【0031】第3比較例として、配向膜27Aのラビング方向を6時～12時の方向と9時～3時の方向とに変更することを除いて第2実施形態と同様な液晶表示装置を製造し、これを実際に駆動する実験を行った。すると、ラビング方向が6時～12時の方向である場合、コントラストが透過光表示で8となる。他方、ラビング方向が9時～3時の方向である場合、コントラストが透過光表示で6になる。従って、この配向不良領域に対応した光漏れにより第2実施形態で得られた20を超えるような透過光表示のコントラストを得ることができない。

【0032】尚、本発明は上述の実施形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変形可能である。例えば、第2実施形態の切欠部25TCは長方形ではなく、例えば楕円形のように長手方向をもつ他の形状であってもよい。さらに、切欠部25TCの数を3個以外の数に変更してもよい。

【0033】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、光漏れの原因となる液晶分子の配向不良を低減できる液晶表示装置およびその製造方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係る液晶表示装置の部分的な断面構造を示す図である。

25T…透過導電層
25R…反射導電層
25TC…切欠部
27A…配向膜
AR…アレイ基板
CT…対向基板
LQ…液晶層
PX…画素領域
W…窓

[illegible]

(72)発明者 山田 義孝
埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2号 株
式会社東芝深谷工場内

(72)発明者 花澤 康行
埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2号 株
式会社東芝深谷工場内

Fターム(参考) 2H090 HB08Y KA05 LA06 LA09
LA15 MB01 MB03
2H091 FA02Y FA08X FA08Z FA11X
FA11Z FA14Z FC26 FD06
GA13 HA07 LA17
2H092 JA24 JA41 MA13 NA25 PA02
PA08 PA10 PA11